

УДК 621.315.592

КИНЕТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В КОМПЕНСИРОВАННОМ n -InSb ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Обзор

Гальперин Ю. М., Гершензон Е. М., Дричко И. Л.,
Литвак-Горская Л. Б.

Представлен обзор результатов цикла исследований природы электропроводности предельно очищенных образцов антимонида индия n -типа. Рассмотрены способы определения концентрации доноров и степени компенсации в этом материале, обсуждается роль свободных и локализованных на донорах электронов в электропроводности при гелиевых температурах. Обсуждение основано на анализе результатов исследования гальваниомагнитных явлений, излучения СВЧ излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов и ультразвука. Рассмотрены способы определения характеристик материала на основе комплекса результатов, полученных с помощью указанных методов. Обсуждается также фото проводимость по примесям в n -InSb.

Введение. Обзор посвящен природе и особенностям электропроводности n -InSb — одного из наиболее интересных узкозонных полупроводников типа Al_{III}Bi_V — n -InSb. К настоящему времени антимонид индия является хорошо изученным полупроводниковым материалом, технология получения монокристаллов которого достигла высокого совершенства. Концентрация электрически активных примесей в чистых образцах не превышает $(1\div 2)\cdot 10^{14}$ см⁻³.

Электроны проводимости в n -InSb имеют исключительно малую эффективную массу ($m^*=0.013 m_e$), что определяет большую подвижность свободных электронов ($\mu_{77K} \approx 1\cdot 10^6$ см²/В·с) и малую энергию ионизации водородоподобных примесей ($\epsilon_0 = 1$ Ry = 0.67 мэВ). Такие параметры материала, во-первых, определяют высокую чувствительность n -InSb к коротковолновому электромагнитному излучению и, во-вторых, предоставляют уникальные возможности для изучения воздействия внешних условий на электронные процессы. Влияние изменения температуры, электрического и магнитного полей, электромагнитного излучения и других параметров приводит к существенным, а иногда радикальным изменениям его свойств. Это, с одной стороны, представляет самостоятельный физический и практический интерес, а с другой — позволяет моделировать целый ряд явлений, присущих другим полупроводникам и электронным системам. Так, например, из-за большого боровского радиуса электрона на доноре ($a=640$ Å) в n -InSb при концентрациях, на 3—4 порядка меньших, чем в Ge и Si, возможно изучение проблемы взаимодействия между примесями и процессов делокализации примесных состояний.

Однако чувствительность к внешним воздействиям имеет и обратную сторону. При наблюдении тех или иных эффектов в n -InSb проявляется такая критичность к внешним условиям, столь сильная зависимость эффектов от характеристик образцов, что проблема интерпретации экспериментальных результатов становится значительно более сложной, чем в других полупроводниках. Поэтому эксперименты с n -InSb требуют особой тщательности, а их интерпретация — хорошего знания условий опыта и параметров образцов (концентрации доноров N_d и компенсации $K=N_a/N_d$), особенно при изучении материала в слабых электрических E и магнитных H полях. Ситуация осложня-

ется тем, что детальной теории кинетических явлений в n -InSb при гелиевых температурах и в слабых E и H нет до настоящего времени. В связи с этим однозначной трактовки экспериментальных результатов можно добиться лишь комплексными исследованиями, когда, например, гальваномагнитные измерения дополняются СВЧ или оптическими, изучением резонансов, поглощения ультразвука и т. д.

Совершенно иная ситуация при изучении n -InSb в сильных E и H . Экспериментальные и теоретические исследования позволили при $1 \leq E \leq 100$ В/см проследить все стадии разогрева свободных электронов и соответствующие изменения механизмов рассеяния (см., например, [1]), изучить воздействие магнитного поля на свободные электроны и водородоподобные атомы в условиях сильного квантования в полях $H \leq 180$ кЭ [2, 3], которые эквивалентны недоступным для лаборатории даже в импульсных режимах воздействиям на соответствующие объекты в свободном пространстве, легко реализовать разнообразные резонансы в квантующих магнитных полях (циклотронный [4], электронный, парамагнитный и комбинированный [5]), изучить влияние сильного H на прыжковую проводимость [6].

В обзоре мы ограничимся рассмотрением кинетических явлений в n -InSb в слабых E и H , в трактовке которых до сих пор имеются противоречивые суждения.

Исключение составляют исследования механизмов проводимости по поглощению ультразвука, где для выделения электронного вклада приходится изучать зависимости поглощения от H в сильных полях.

Отметим, что в целом ряде опубликованных работ не содержатся все необходимые для интерпретации экспериментов сведения. Это существенно затрудняет анализ и сопоставление результатов. Как правило, далее подробно обсуждаются лишь работы, в которых содержится достаточная информация об условиях эксперимента и параметрах исследованного материала.

Обзор построен по следующему плану. В разделе 1 анализируются методы определения N_d , K и дается характеристика современного предельно очищенного n -InSb. В разделе 2 обсуждается роль свободных и примесных электронов в электропроводности n -InSb при гелиевых температурах. В разделах 3, 4 рассматриваются механизмы проводимости по примесям и характер примесных состояний в чистом n -InSb при различных K . Раздел 5 посвящен анализу роли свободных и локализованных на донорах электронов в поглощении ультразвука. В разделе 6 приведена модель фотопроводимости по примесям.

1. Методы определения концентрации доноров и степени компенсации в n -InSb

Анализ механизмов низкотемпературной проводимости невозможен без знания концентраций доноров N_d и компенсации K . По концентрации остаточных доноров предельно очищенный n -InSb соответствует случаю $N^{l.s}a \leq 0.3$, поэтому температурная зависимость постоянной Холла $R_H(T)$ практически не может использоваться для определения N_d и K . Существует несколько иных методов определения N_d и K в n -InSb, которые имеют ограниченную область применения и не одинаковы для слабо и сильно компенсированных материалов. Пренебрежение этим приводит к существенным различиям в значениях N_d и K , найденных разными авторами для образцов с практически одинаковыми $N_d - N_a$ и подвижностями при температуре жидкого азота $\mu_{\text{7 K}}$.

Для слабо компенсированного n -InSb ($K < 0.7$) наиболее употребительным является определение суммарной концентрации примесей $N_d + N_a$ по значениям подвижности в условиях рассеяния на ионизованных примесях — μ . Измерения $\mu(T)$ проводятся либо в диапазоне $T = 20 \div 40$ К, где преобладает рассеяние электронов на ионизованных примесных центрах [7, 8], либо при $T = 77$ К, где наряду с решеточным еще существенно примесное рассеяние. В последнем случае для выделения примесного рассеяния из полной подвижности необходимо знать вклад рассеяния на акустических и оптических фонах. В [7] показано, что при $T = 77$ К расчетное значение подвижности при

рассеянии на акустических и оптических фононах $(\mu_a^{-1} + \mu_o^{-1})^{-1}$ составляет $1.8 \cdot 10^6 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, при этом $\mu_a = 4.4 \cdot 10^6 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ и $\mu_o = 2.9 \cdot 10^6 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$.

Следует заметить, что по мере роста $N_d + N_a$ точность определения $N_d + N_a$ по μ падает, но даже при $N_d + N_a \sim 10^{15} \text{ см}^{-3}$ она не хуже 50 %.

Для n -InSb (как и для других полупроводников типа $A_{III}B_V$) возможен и другой метод определения $N_d + N_a$ — по подвижности электронов при $T = 4.2 \text{ К}$ в сильном электрическом поле μ (E), когда рассеяние импульса электронов происходит на ионизованных примесях, а энергии — при спонтанной эмиссии оптических фононов [1]. В [1] приведены номограммы для расчета $N_d + N_a$ по μ (E). Отметим, что точность нахождения $N_d + N_a$ из μ (E) такая же, как из μ (T).

Наибольший разброс значений N_d и K получается при вычислении $N_d + N_a$ в сильно компенсированных материалах по μ (T) = $R_H \sigma$ при $T = 4.2$ и 77 К . В [9] показано, что при $K \rightarrow 1$ за счет большого флуктуационного потенциала подвижность свободных носителей заряда должна уменьшаться и иметь температурную зависимость, более сильную, чем по формуле Брукса—Херринга.

Представление о влиянии компенсации на характер температурной зависимости подвижности свободных электронов дает рис. 1 [10], где приведены результаты измерения μ (T) пяти образцов n -InSb с $N_d \sim 1.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и $N_d - N_a$, варьирующих от $7 \cdot 10^{13}$ до $5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$. Видно, что чем меньше $N_d - N_a$ (больше

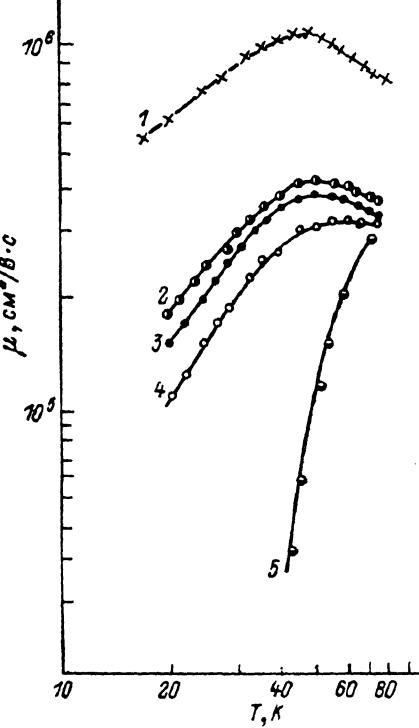


Рис. 1. Температурные зависимости подвижности электронов в n -InSb.

$N_d = 1.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$. $(N_d - N_a) \cdot 10^{-13}$, см^{-3} : 1 — 7, 2 — 2.6, 3 — 1.8, 4 — 1.2, 5 — 0.5

компенсация), тем ниже значения μ (T) во всем диапазоне температур и тем круче зависимость μ (T) при $T < 40 \div 60 \text{ К}$.

В [11] по поглощению ультразвука найдены значения подвижности свободных электронов в n -InSb с $K = 0.84$ и 0.89 ($N_d \simeq 10^{14} \text{ см}^{-3}$) при $T = 4.2 \text{ К}$, которые оказались близкими к расчетным по формуле Брукса—Херринга и значительно выше найденных из $R_H \sigma$ по измерениям на постоянном токе. В [11] обсуждается вопрос, почему $\mu = R_H \sigma$ не определяет подвижность свободных электронов при гелиевых температурах.

Для компенсированного n -InSb весьма удобен, на наш взгляд, метод нахождения N_d по коэффициенту распределения доноров в InSb [12]. Он основан на том, что вследствие разницы в коэффициентах распределения G доноров и акцепторов в InSb ($G = 0.5$ для остаточных доноров и $G \simeq 0.04$ для обычно использующихся компенсирующих примесей Ge и Mn) дополнительно компенсированные слитки всегда имеют $p-n$ -переход. Поскольку боровский радиус дырки на акцепторе a_p существенно меньше боровского радиуса электрона на доноре, p -область слитка является слабо легированной ($N_a^{1/2} a_p \ll 1$) и в ней возможно определение концентрации компенсирующих примесей N_d по $R_H(T)$ [13]. К полученным значениям N_d «привязывается» кривая распределения доноров для всего слитка; зная N_d и независимо измеряя $N_d - N_a$ при $T = 77 \text{ К}$, можно найти K в образцах из n -части слитка. В табл. 1 представлены значения $N_d + N_a$ компенсированного n -InSb, вычисленные различными методами. Видно, что практически при одних и тех же $N_d - N_a$ и $\mu_{77 \text{ K}}$ значения N_d

полученные из $\mu = R_H \sigma$ с использованием формулы Брукса—Херринга, в несколько раз больше, чем определенные по кривой распределения доноров в InSb. Это и порождает в ряде случаев неоднозначность в интерпретации экспериментальных результатов и затрудняет анализ литературных данных в рамках настоящего обзора, особенно в том случае, когда в статье содержатся только значения $N_d - N_a$ и K (или N_d) и не приводится величина μ_{77} к.

Таблица 1

$(N_d - N_a) \times 10^{-13}, \text{см}^{-3}$	$\mu_{77} K \cdot 10^{-5}, \text{см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$	$K = \frac{N_a}{N_d}$	$(N_d + N_a) \times 10^{-14}, \text{см}^{-3}$	Способ определения $N_d + N_a$	Литературный источник
0.25	3.2	0.99	11	По $\mu(T)$ с использованием формулы Брукса—Херринга	[14]
0.08	1.5	0.99	98		
0.8	4.0	0.94	2.5	По кривой распределения примесей в InSb	[12]
0.1	3.5	0.99	2.8		
0.01	2.7	0.99	2.8		

Приведем параметры имеющегося в настоящее время монокристаллического n -InSb, обсуждение физических явлений в котором при гелиевых температурах составляет содержание настоящего обзора. В нелегированном предельно очищенном материале $N_d - N_a \approx (5 \div 10) \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ и $\mu_{77} K \approx (6 \div 10) \cdot 10^5 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, концентрация остаточных доноров $N_d = (0.7 \div 1.5) \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и компенсация $K = 0.2 \div 0.7$.

В предельно очищенном и дополнительно компенсированном материале $N_d - N_a \leq 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $\mu_{77} K \approx (2 \div 5) \cdot 10^5 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, $N_d \approx (1 \div 1.5) \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и $K \geq 0.8$.

2. Роль свободных и примесных электронов в электропроводности n -InSb при гелиевых температурах

Вклад в электропроводность σ n -InSb свободных n_c и примесных n_d электронов может быть существенно различным в зависимости от температуры и условий эксперимента. Если ограничить рассмотрение диапазоном магнитных полей $H \leq 1 \text{ кЭ}$, то в материале с $N_d - N_a \geq 3 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ при $T \geq 20 \text{ К}$ σ определяется только электронами проводимости [7, 8]. Информация о зависимости $n_c(T)$ и $n_d(T)$ может быть получена из анализа экспериментальных результатов по $R_H(T)$ и $\rho(T)$ (ρ — удельное сопротивление).

Типичные графики $R_H(T^{-1})$ и $\rho(T^{-1})$ в диапазоне $T = 0.3 \div 77 \text{ К}$ для нескольких образцов n -InSb с различными N_d и K представлены на рис. 2 [15].

Таблица 2

№ образца	$(N_d - N_a) \times 10^{-13}, \text{см}^{-3}$	$\mu_{77} K \cdot 10^{-5}, \text{см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$	$N_d \cdot 10^{-14}, \text{см}^{-3}$	K	Энергия активации, мэВ				$T_0 \cdot 10^{-4}, \text{К}$
					ϵ_1	ϵ_{dH}	ϵ_2	ϵ_3	
1	22	3.0	6.0	0.50	—	—	—	—	—
2	15	7.9	2.0	0.25	0.24	—	—	—	—
3	8.8	9.0	1.6	0.45	0.32	—	0.04	—	—
4	4.4	11.0	0.9	0.5	0.40	—	0.03	—	—
5	3.0	12.6	0.7	0.56	0.35	—	0.05	—	—
6	1.8	4.6	1.2	0.85	1.0	1.2	—	0.3	0.4
7	1.3	4.2	1.2	0.89	1.5	1.4	—	0.8	1
8	0.8	4.0	1.3	0.94	2.0	1.75	—	1.0	4
9	0.1	3.0	1.4	0.96	4.0	—	—	—	8
10	0.01	3.0	1.4	0.99	17	—	—	—	20

(R_H) измерено при $H=100$ Гц).¹ Параметры образцов даны в табл. 2. Видно, что в образцах с $N_d - N_a \leq 10^{14}$ см⁻³ ρ монотонно возрастает с уменьшением температуры; на зависимости $R_H(T^{-1})$ наблюдается максимум R_{Hm} при $T \approx 8 \div 4$ К. Начиная с $T \leq 2$ К R_H выходит на постоянное значение, близкое к R_H в области источника примесей ($R_{H\text{ ист}}$). В образцах с $N_d - N_a > 2 \cdot 10^{14}$ см⁻³ отношение $R_{Hm}/R_{H\text{ ист}} \approx 1.1$, а $\rho(T)$ при $T < 10$ К практически не зависит от температуры.

В интерпретации $R_H(T)$ использовались два разных подхода. Считалось, что примесные состояния образуют единый континuum с зоной проводимости (все электроны свободны) [19, 20], а примесные состояния образуют зону, отделенную от дна зоны проводимости энергетическим зазором ε_d (полная проводимость определяется электронами зоны проводимости и примесной — двузонная модель проводимости) [15-18]. В первом случае изменение R_H при понижении температуры отождествлялось с температурной зависимостью холл-фактора r при смене рассеяния электронов с решеточного на рассеяние ионизованными примесями $T=40$ К [7], а далее — с изменением степени вырождения электронного газа (температура вырождения ~ 7 К при $n_c = 5 \times 10^{13}$ см⁻³). Согласно таким рассуждениям, область изменения R_H должна соответствовать $T \approx 40 \div 7$ К, а в эксперименте диапазон изменения $R_H(T)$ (включая максимум) соответствует $T =$

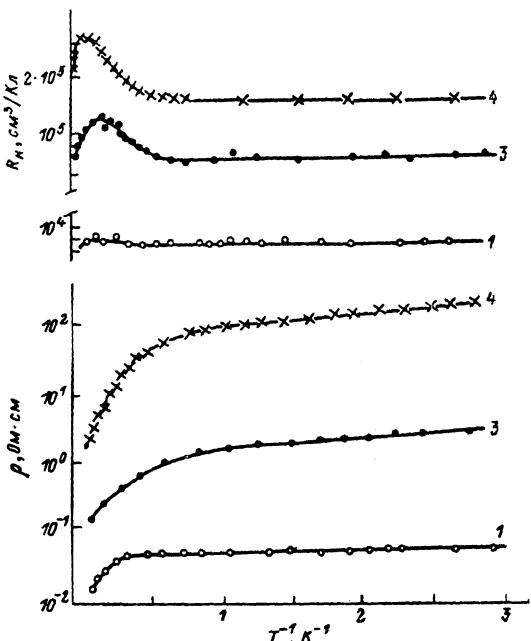


Рис. 2. Температурные зависимости постоянной Холла и удельного сопротивления в области 0.3—77 К [15]. Цифры у кривых соответствуют номерам образцов в табл. 2.

$=15 \div 2$ К [15]. Более того, температура, при которой наблюдается R_{Hm} , в зависимости от компенсации (при одинаковых $N_d - N_a$) изменяется от 8 до 4 К [15]. В [15-18] максимум на зависимости $R_H(T)$ связывался с переходом от проводимости по свободной зоне к проводимости по примесной зоне. Механизм примесной проводимости не детализировался, предполагалось только, что электронам в примесной зоне может быть приписана некоторая подвижность μ_d . Проведенные в рамках двузонной модели расчеты, которые следует рассматривать как сугубо приближенные, показали, что при $T=4.2$ К концентрация свободных носителей заряда $n_c < N_d - N_a$, а ширина энергетического зазора между зоной проводимости и примесной $\varepsilon_d \approx 0.3 \div 0.4$ мэВ ($\sim 0.4 \div 0.6$ Ry) [15, 17]. На рис. 3 представлены графики зависимости отношения $n_c/(N_d - N_a)$ от $(N_d - N_a)$ для $T=10$ и 4.2 К по данным [11, 15, 17]. Действительно, при $T \leq 10$ К для рассмотренных образцов n_c не превышает $0.3(N_d - N_a)$. Анализ графиков рис. 2 и обобщение данных работ [11, 21-23], экспериментальные результаты которых обсуждаются далее, позволяют определить температуру T_{imp} , ниже которой преобладает проводимость по примесям. На рис. 3 представлен график зависимости T_{imp} от $N_d - N_a$, построенный по данным [11, 21-23]. Видно, что T_{imp} тем больше, чем меньше $N_d - N_a$ (больше K). При $T > T_{imp}$ проводимость определяется как свободными, так и примесными электронами. В образцах с $N_d - N_a \leq 2 \cdot 10^{13}$ см⁻³ значения n_c при $T=4.2$ К определены по поглощению ультразвука [11]. Они показывают, что при $N_d - N_a \leq 2 \cdot 10^{13}$ см⁻³ вклад в низкотем-

¹ Подобные зависимости $R_H(T^{-1})$ и $\rho(T^{-1})$ получены в [16-18] на аналогичных по параметрам образцах n -InSb. Следует отметить, что экспериментальные результаты, как правило, не имеют расхождений, различия есть только в их интерпретации.

пературную проводимость за счет свободных электронов мал, поскольку $n_c/(N_d - N_a) \leq 10^{-2}$. Это же следует из зависимости $T_{\text{imp}}(N_d - N_a)$, полученной из $\rho(T)$ [23].

В [18] использован иной метод доказательства существования отделенной примесной зоны в n -InSb с $N_d - N_a < 10^{14} \text{ см}^{-3}$, основанный на сопоставлении значений постоянной Холла в области истощения примесей R_H ист и при $T \rightarrow 0 \text{ K}$ (R_{H_0}). Авторами [18] показано, что совпадение R_{H_0} с R_H ист имеет место лишь при $N_d - N_a > 6 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$. Различие в R_{H_0} и R_H ист при $N_d - N_a \leq 6 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ рассматривается как проявление перехода Мотта [24].

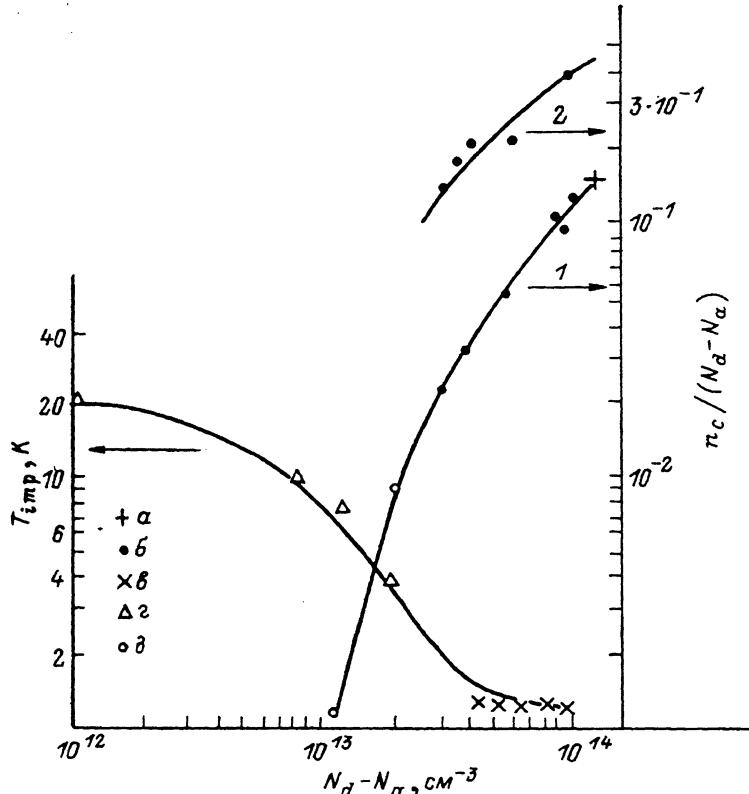


Рис. 3. Зависимости от $(N_d - N_a)$ максимальной температуры T_{imp} , соответствующей примесной проводимости, и относительной концентрации свободных электронов $n_c/(N_d - N_a)$.

Т, К: 1 — 4.2, 2 — 10. Литературный источник: а — [17], б — [18], в — [21], г — [22], д — [21].

При анализе экспериментальных результатов двузонная модель может рассматриваться как первое (весьма грубое) приближение, поскольку в ней не детализируются механизмы проводимости по примесям. В полупроводниках же при различной степени легирования и компенсации наблюдается несколько видов примесной проводимости.²

Анализ экспериментальных результатов при наличии проводимости по примесям производится, как правило, с использованием формулы Фрицше [26], учитывающей аддитивный вклад каждого вида проводимости в полную:

$$\sigma \equiv \rho^{-1} = \rho_{01}^{-1} \exp\left(-\frac{\epsilon_1}{kT}\right) + \rho_{02}^{-1} \exp\left(-\frac{\epsilon_2}{kT}\right) + \rho_{03}^{-1} \exp\left(-\frac{\epsilon_3}{kT}\right), \quad (1)$$

где ϵ_1 — энергия ионизации примесного центра, ϵ_2 — энергия активации проводимости по зоне делокализованных состояний (зоне ϵ_2 или верхней зоне Хаббарда), ϵ_3 — энергия активации прыжковой проводимости по основным состоя-

² Изложение вопросов, связанных с примесной проводимостью в полупроводниках, содержится в ряде монографий (см., например, [24, 25]).

ним примесных центров. Заметим, что проводимость с энергией активации ϵ_2 наблюдается в случае так называемого промежуточного легирования ($0.25 \geq N^{1/3}a \geq 0.08$ [24]), а переход металл—диэлектрик — переход Мотта ($N^{1/3}a \approx 0.25$ при $K \rightarrow 0$) рассматривается в [24] как исчезновение энергетической щели в плотности состояний (энергии ϵ_2). При $T \rightarrow 0$ прыжковая проводимость с энергией активации ϵ_3 сменяется проводимостью с переменной длиной прыжка (мотовской) [24, 25].

Мы, подобно [27], проиллюстрируем переход металл—диэлектрик для n -InSb при произвольных K и N_d ($N_d^{1/3}a \ll 1$) исходя из модели Андерсона [24, 25], согласно которой локализация при наличии потенциальных ям случайной глубины определяется отношением между характерным разбросом глубин ям W и значением энергетического интеграла перекрытия $I = I_0 \exp(-2R/a)$:

$$W/I \ll A, \quad (2)$$

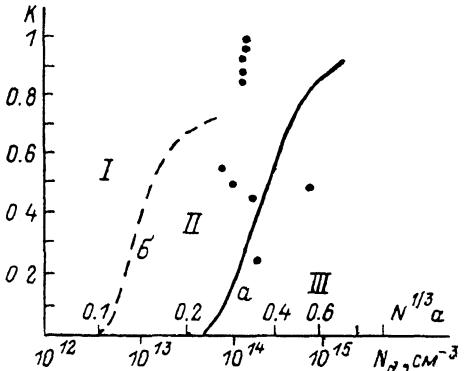
где I_0 — энергия связи основного состояния, $R = (4/3 \pi N)^{-1/3}$ — средний радиус сферы, занимаемой примесным центром, A — число, зависящее от типа кристаллической решетки; для решетки типа алмаза $A = 8$ [25].

Будем считать, как в [24], что W определяется кулоновским потенциалом заряженных примесей вследствие компенсации. Тогда для любых K

$$W = \frac{1}{2} f(K) \frac{e^2}{\pi} \sqrt[3]{N_d}. \quad (3)$$

Рис. 4. Критерий локализации Андерсона применительно к n -InSb.

a — расчет по (2) и (3), b — обобщение экспериментальных результатов в n -Ge [27, 30]. Точки — образцы (табл. 2).



Вид функции $f(K)$ рассчитан в [28]; в предельных случаях $K \rightarrow 0$, $f(K) = -0.26 K^{1/4}$ и $K \rightarrow 1$ ($1-K \ll 0$) $f(K) = (1-K)^{-1/3}$. На рис. 4 представлен график зависимости N_d от K , полученный по (2) и (3). Область слева от кривой a соответствует N_d и K , при которых электроны должны быть локализованы на примесях, справа — делокализованы. На рис. 4 приведены также максимальные при данном K значения N_d , при которых экспериментально наблюдалась проводимость ϵ_2 в n -Ge [27] (кривая b).

Таким образом, рис. 4 позволяет проследить за изменением характера примесной проводимости в широком диапазоне N_d и K . Область I соответствует случаю прыжковой проводимости, которая в сильно компенсированных полупроводниках может наблюдаться при любой степени легирования. В области II электроны локализованы в основных состояниях (зона ϵ_3) и существует проводящая зона ϵ_2 . Область III соответствует проводимости металлического типа. Из рис. 4 видны две возможности исследования примесной проводимости в n -InSb: при $N_d = \text{const}$ можно или увеличивать компенсацию, или уменьшать радиус локализации электрона на доноре, помещая n -InSb в сильное магнитное поле.³ Нами рассматриваются в основном вопрос о влиянии компенсации на механизмы проводимости по примесям и характер примесных состояний в n -InSb, при этом выделяются два диапазона компенсаций $0.2 \leq K \leq 0.7$ и $K > 0.8$.

3. Примесная проводимость в предельно очищенном n -InSb при $0.2 \leq K \leq 0.7$

Для рассматриваемого диапазона компенсаций характерны зависимости $R_H(T)$ и $\rho(T)$, представленные на рис. 2 (образцы 3 и 4).

³ Смена механизмов проводимости по примесям в сильных H впервые наблюдалась в [29] и здесь обсуждаться не будет.

Авторы [21] предположили, что $\rho(T)$ при $T \leq 1$ К определяется проводимостью по зоне ϵ_2 , т. е. $\rho(T) = \rho_{02} \exp(\epsilon_2/kT)$. Конечно, это предположение вряд ли можно было бы считать обоснованным, поскольку зависимость $\rho(T)$ в диапазоне $T=1 \div 0.3$ К чрезвычайно слабая и описание ее экспонентой, — по-видимому, не единственная возможность. Однако в [21] проведено сопоставление зависимости энергии ϵ_2 от $N_d - N_a$, K и H с соответствующими зависимостями для n -Ge [30] и показана их полная идентичность.⁴

Для выяснения характера примесных состояний в n -InSb с $K \leq 0.7$ авторами [32] предпринято исследование спектральной зависимости коэффициента поглощения α электромагнитного излучения в диапазоне длин волн $\lambda = 3.8 \div 8$ мм и влияния на него T , E , H и параметров материала. Отметим, что изучение $\alpha(T, E, H, N_d, K)$ в [32] выполнено на образцах ранее исследованных на постоянном токе (рис. 2).

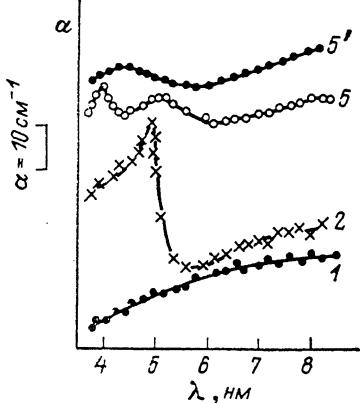


Рис. 5. Зависимости коэффициента поглощения α от длины волны СВЧ излучения для трех образцов n -InSb с различными N_d и K [32].

Цифры у кривых соответствуют номерам образцов в табл. 2. 5' — образец 5 при $T=4.2$ К.

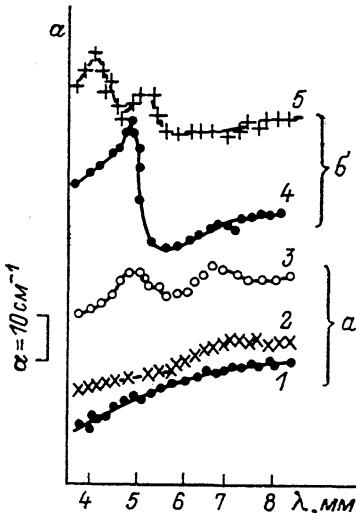


Рис. 6. Зависимости коэффициента поглощения от длины волны в образцах 1 (а) и 2 (б) [32]. $T=1.3$ К. H , кЭ: 1, 4 — 0; 2, 5 — 3; 3 — 5.

Изучение влияния электромагнитного излучения СВЧ на электропроводность, измерение коэффициента поглощения начались в n -InSb почти одновременно с исследованием гальваномагнитных явлений сразу же после обнаружения чувствительности n -InSb к излучению миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн.

Первые же измерения [33] показали, что при $\lambda = 4$ мм в образцах с $N_d - N_a \leq 6 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ α превышает рассчитанный по величине статической проводимости σ_0 коэффициент поглощения ($\alpha_0 = 4\pi\sigma_0/\sqrt{\lambda}$). С уменьшением $N_d - N_a$ разница в α и α_0 увеличивается: в образце с $N_d - N_a = 6 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ $\alpha/\alpha_0 = 1.5$, а в образце с $N_d - N_a \approx 10^{13} \text{ см}^{-3}$ $\alpha/\alpha_0 = 10$. Приблизительно также различаются подвижности, найденные на $\lambda = 8$ мм по эффекту Фарадея и на постоянном токе [34]. Однако в [33, 34] результаты получены на одной или нескольких длинах волн. Для выяснения характера примесных состояний необходимы спектральные измерения $\alpha(\lambda)$ в широком диапазоне N_d и K , которые были выполнены в [32].

⁴ Необходимо заметить, что высказанное в [21] и [30] предположение о существовании проводимости по зоне ϵ_2 в n -InSb и n -Ge при $K \sim 0.8 \div 0.9$, по-видимому, ошибочно, поскольку в более поздних работах показано, что при $K > 0.8$ в n -InSb [29], как и в n -Ge [31], наблюдается только примесная прижковая проводимость по локализованным состояниям.

Графики $\alpha(\lambda)$ (рис. 5) для трех образцов n -InSb с разными N_d и K дают представление о спектре примесных состояний вблизи перехода металл—изолятор [32]. В образце 1 зависимость $\alpha(\lambda)$ монотонна и соответствует поглощению на свободных носителях заряда. Кривая $\alpha(\lambda)$ для него вполне удовлетворительно описывается формулой Друде при $\tau=2 \cdot 10^{-12}$ с. Определенное по высокочастотной проводимости σ при $\lambda=8$ мм совпадает с σ_0 по постоянному току. Зависимость $\alpha(\lambda)$ образца 2 немонотонна. Наблюдаемый пик поглощения при $\lambda=5$ мм, соответствующий энергии кванта излучения $h\nu \approx 0.25$ мэВ ≈ 0.4 Ry, по-видимому, подтверждает высказанное Моттом соображение [24], что максимум в плотности примесных состояний под проводящей зоной исчезает только при концентрациях, приблизительно на порядок больших, чем в переходе металл—изолятор. В образце 3, в котором $N_d^2/a \approx 0.25$, но вследствие компенсации имеется уже отделенная проводящая примесная зона, на зависимости $\alpha(\lambda)$ наблюдаются два пика поглощения. По мнению авторов [32], коротковолновый пик связан с ионизацией электронов из зоны основных состояний ($\hbar\omega \approx \epsilon_1$), длинноволновый — с ионизацией из зоны ϵ_2 ($\hbar\omega \approx \epsilon_1 - \epsilon_2$). Полученные значения энергии из $\alpha(\lambda)$ близки к данным гальваномагнитных измерений.

Представленный на рис. 5 график $\alpha(\lambda)$ образца 5 при $T=4.2$ К имеет один слабо выраженный пик поглощения, что неудивительно, так как при этой температуре $kT \gg \epsilon_2$. В итоге образуется единая примесная зона, и двузонная модель проводимости, где вводится для примесной зоны единая подвижность μ_{ν} , дает разумные результаты для $R_{\text{ш}}(T)$ и $\rho(T)$ в диапазоне $T=3 \div 8$ К.

В [32] исследовано также влияние магнитного поля на характер зависимости $\alpha(\lambda)$. На рис. 6 представлены графики $\alpha(\lambda)$ в образцах 1 и 2 при $H=0 \div 5$ кЭ. Видно, что в образце 1 монотонный спад α с λ при $H=0$ в магнитном поле $H=-3$ кЭ сменяется слабо выраженным пиком поглощения на $\lambda=7$ мм; в магнитном поле $H=4$ кЭ — уже два пика поглощения, что соответствует появлению зоны ϵ_2 . В образце 2 зона ϵ_2 появляется уже при $H=3$ кЭ, о чем свидетельствуют два пика поглощения на зависимости $\alpha(\lambda)$ вместо одного при $H=0$. Таким образом, уменьшение в магнитном поле эффективной длины спада волновой функции электрона на доноре приводит к такому же изменению характера примесных состояний, как и компенсации (при $K \leqslant 0.7$).

Таким образом, проведенное в [32] комплексное исследование ряда образцов n -InSb показывает, что, по-видимому, в материале с $N_d \sim 10^{14}$ см⁻³ при $K > 0.2$ электроны в основном состоянии локализованы и существует проводящая примесная зона, определяющая зависимость $\rho(T)$ при $T < 1.5$ К.

4. Примесные состояния и проводимость в сильно компенсированном n -InSb

Комплексное исследование гальваномагнитных явлений и поглощения в сильно компенсированном n -InSb ($K > 0.8$) выполнено в [23]. На рис. 7 представлены графики $\rho(T)$ пяти образцов n -InSb с $K \geqslant 0.85$ при $T=4.2 \div 77$ К (параметры образцов даны в табл. 2). Видно, что при $0.85 \leqslant K \leqslant 0.96$ (образцы 6—8) на $\rho(T)$ наблюдается два экспоненциальных участка, которые авторами отождествляются с энергиями активации ϵ_1 и ϵ_3 , причем $\epsilon_1 > 1$ Ry (табл. 2). При $K > 0.96$ (образцы 9, 10) есть только один участок экспоненциальной зависимости с энергией активации ϵ_1 ; в области низких температур наблюдается, по мнению авторов, прыжковая проводимость по состояниям вблизи уровня Ферми (моттовская прыжковая проводимость). В этих образцах $\epsilon_1 > 4$ Ry (табл. 2). Проведенное в [22] исследование магнитосопротивления в образцах 6—9 подтвердило в соответствии с [25] прыжковый характер проводимости в них при гелиевых температурах.

Представленные на рис. 8 графики $\alpha(\lambda)$ образцов 6 и 7 имеют иной характер, чем в n -InSb с $K \leqslant 0.7$. Интерпретируя полученные результаты, авторы [23] пришли к выводу, что примесные состояния образуют комплексы типа иона молекулы водорода H_2^+ (D_2^+). Фактически это означает, что при рассмотрении мелкомасштабных флуктуаций примесного потенциала в случае промежуточного легирования необходимо учитывать квантовые эффекты, так как расстояние между примесями $r \gg a$.

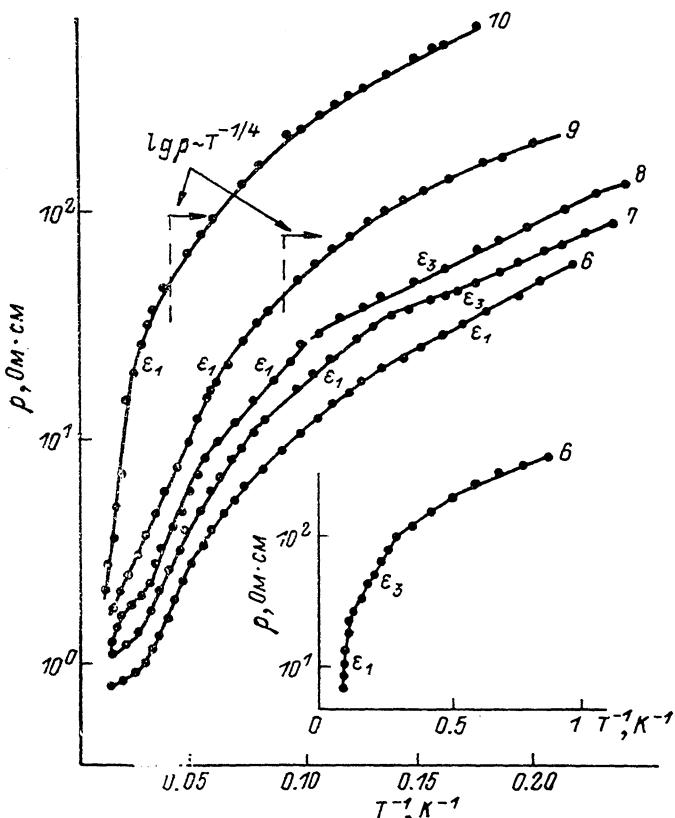


Рис. 7. Температурные зависимости удельного сопротивления при $N_d = \text{const}$ и различных K [23].

Цифры у кривых соответствуют номерам образцов в табл. 2.

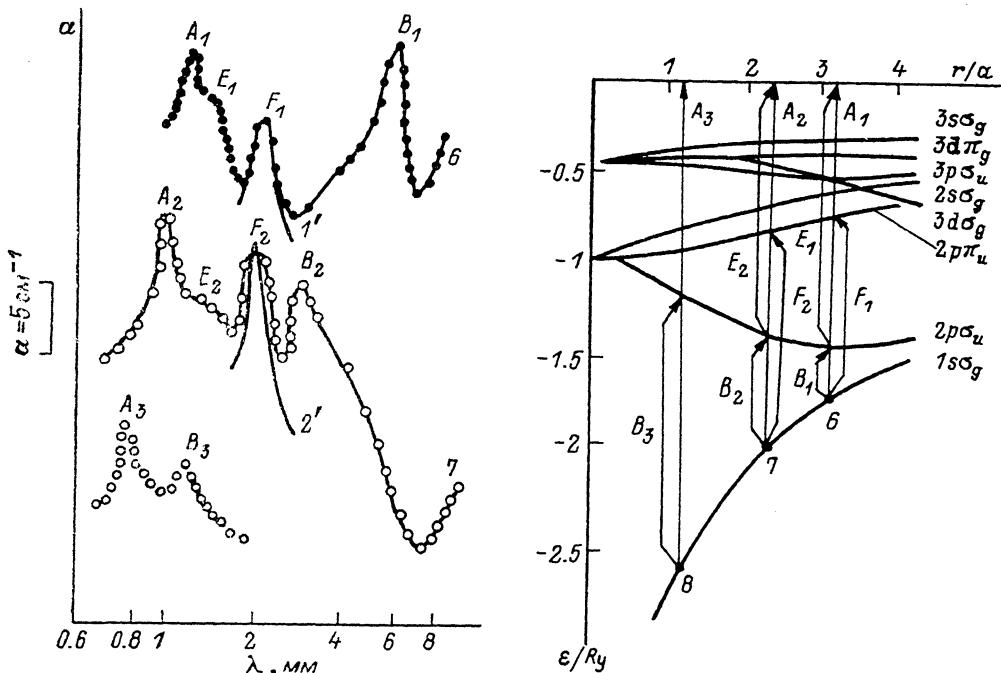


Рис. 8. Зависимость коэффициента поглощения от длины волны и переходы внутри $D_{\frac{5}{2}}$ -комплексов, соответствующие пикам поглощения [23].

$T = 1.6$ К. Цифры у кривых соответствуют номерам образцов. $1'$, $2'$ — расчет [4]. r/a : $1' = 3.3$, $2' = 2.5$.

Для идентификации экспериментальных результатов были использованы рассчитанные в [35, 36] термы иона молекулы водорода при различном расстоянии между ядрами (рис. 8). Полагая, что коротковолновый пик поглощения соответствует фотоионизации локализованных электронов, по его энергии $\hbar\omega = e$, находим характерное для каждого образца r/a . По известному r/a определяются энергии внутримолекулярных переходов и сопоставляются с пиками поглощения на зависимостях $\alpha(\lambda)$. Оказалось, что определенные таким образом энергии переходов отличались от измеренных менее чем на 7 %.

Вертикальными стрелками на рис. 8 показаны наблюдавшиеся переходы между уровнями H_2^+ -комплексов, буквенные обозначения для переходов и для пиков поглощения одинаковы. Полного расчета вида спектра H_2^+ -комплексов в полупроводниках нет. Однако полученные наиболее интенсивные пики поглощения соответствуют наибольшей силе осцилляторов для дипольных переходов [35, 36].

Работа [23] была, по-видимому, первой, показавшей существование молекулярных образований из водородоподобных примесных атомов. Несколько позже и независимо от нее теоретически была рассмотрена возможность возникновения примесных комплексов типа молекул водорода H_2 и ее иона H_2^+ (D_2 и D_2^+) в полупроводниках при $6 \leq r/a \leq 20$ и рассчитаны некоторые особенности спектров поглощения, характерные для таких молекул [37, 38]. Проведенное затем исследование подтвердило существование ионов молекулы водорода D_2^+ в сильно компенсированном n -GaAs, n -InP [39, 40].

В [41] рассчитан спектр донорных молекул $D_2^+(H_2^+)$ для малых расстояний r в донорных парах ($r \leq 4a$) для линий поглощения, вырождающихся в переход $1s \rightarrow 2p$ в изолированном доноре ($r \rightarrow \infty$). На рис. 8 представлены рассчитанные пики поглощения для переходов $1s_{\sigma_g} \rightarrow 2p_{\sigma_u}$, $2p_{\sigma_u} \rightarrow 2s_{\sigma_g}$, $2p_{\sigma_u} \rightarrow 3d_{\sigma_g}$, $2p_{\sigma_u} \rightarrow 3d_{\pi_g}$ при $r=2.5a$ и $r=3.3a$, соответствующие наблюдаемым пикам F в образцах 6 и 7. Видно вполне хорошее совпадение расчета с экспериментом. Это показывает, что подавляющее большинство электронов локализовано на донорных парах $D_2^+(H_2^+)$ с характерным для выбранных N_d и K средним расстоянием в паре r/a .

В очень сильно компенсированном n -InSb с $K \geq 0.98$ спектр поглощения имеет колоколообразную частотную зависимость, отличную от представленных на рис. 8.

В настоящее время вопрос о поглощении излучения в условиях моттовской прыжковой проводимости теоретически недостаточно изучен; можно указать лишь работы [42, 43], где рассмотрена стимулированная фотонами прыжковая моттовская проводимость при поглощении фотонов с энергией $\hbar\omega \gg kT$. В [43] проанализированы экспериментальные результаты [23] и показано, что особенности $\alpha(\lambda)$ в n -InSb при $K \geq 0.98$ вполне удовлетворительно описываются в рамках предлагаемой теории.

5. Исследование механизмов проводимости в n -InSb акустическими методами

Весьма информативным при исследовании механизмов проводимости в n -InSb оказалось изучение поглощения ультразвука. Звуковая волна, распространяющаяся в пьезоактивном направлении, вызывает волну потенциального электрического поля с частотой ультразвука ω и волновым вектором \mathbf{q} ($q=\omega/s$, s — скорость звука в данном направлении). Указанная волна пьезоэлектрического поля приводит к протеканию токов, а следовательно, к выделению джоулева тепла. В итоге возникает электронный вклад в поглощение ультразвука, зависящий от $\alpha_{qq}(\mathbf{q}, \omega)$ — комплексной проводимости системы в направлении волнового вектора \mathbf{q} на частоте ω .

Важно, что вклады в поглощение свободных электронов и электронов, локализованных на донорах, существенно различаются по зависимостям от магнитного поля и частоты. Тем самым создается возможность их раздельного изучения.

В случае, когда за поглощение ответственны электроны проводимости и $qL \ll 1$ (L — длина свободного пробега электрона), поглощение ультразвука Γ_e описывается формулой Гуревича—Уайта [44, 45]

$$\Gamma_e = 8.68 \frac{k^2 \omega}{2s} \frac{\omega \tau_M}{(1 + q^2/\tau_i^2)^2 + \omega^2 \tau_M^2}, \quad (4)$$

где k — константы пьезоэлектрической связи, зависящая от поляризации и направления распространения волны; $\tau_M = \pi/4\pi\sigma_{qq}$ — максвелловское время

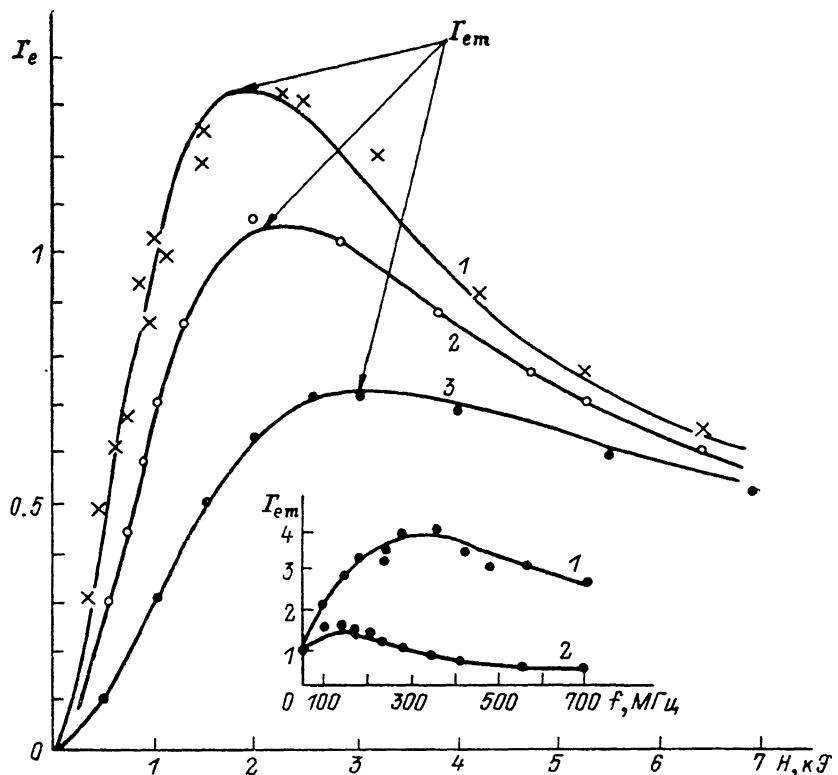


Рис. 9. Зависимость электронного поглощения ультразвука Γ_e в n -InSb, легированного Cr и Mn, от напряженности магнитного поля.

$T=77$ К. f , МГц: 1 — 97, 2 — 227, 3 — 420. На вставке — частотные зависимости максимального по магнитному полю коэффициента поглощения Γ_{em} . T , К: 1 — 90, 2 — 77.

релаксации, характеризующее рассасывание сгустка электронов за счет процессов проводимости, описываемых компонентой тензора статической проводимости; $\tau = (4\pi e^2 n_c / \omega kT)^{1/2}$ — величина, обратная радиусу экранирования Дебая—Хюкеля.

Для выделения из полного поглощения электронного вклада Γ_e в n -InSb измеряется акустоэлектронное взаимодействие во внешнем магнитном поле, поскольку вследствие высокой подвижности электронов и их малой эффективной массы уже относительно слабые магнитные поля существенно влияют на компоненту тензора проводимости σ_{qq} , оставляя неизмененным решеточный вклад (обусловленный ангармонизмом колебаний и дефектами решетки) [46, 47].

Так, например, если звук распространяется в плоскости, перпендикулярной направлению сильного неквантующего поля H ($q \perp H$), то $\sigma_{\perp} \sim H^{-2}$, а $\tau_M \sim H^2$. Это приводит к немонотонной зависимости Γ_e не только от ω [см. (4)], но и от H , причем максимум $\Gamma_e(H, \omega)$ при фиксированной температуре определяется только концентрацией свободных электронов n_c :

$$\Gamma_{em}^{(n)} = 1.1 k^2 \sqrt{4\pi e^2 n_c / \omega kT}. \quad (5)$$

⁵ Приводимые в дальнейшем значения Γ имеют размерность дБ/см.

Представленные на рис. 9 экспериментальные зависимости [48] $\Gamma_e(H)$ для n -InSb, легированного Cr и Mn, при $T=77$ К показывают наличие максимумов Γ_e по H [$\Gamma_{em}(\omega)$] во всем диапазоне частот ультразвука 50–300 МГц. Графики $\Gamma_{em}(\omega)$ при $T=77$ и 90 К (см. вставку на рис. 9) также имеют максимум, что подтверждает справедливость проведенных выше рассуждений.

В [48] по Γ_{em} с использованием (5) найдена зависимость $n_c(T)$ в диапазоне температур 77–100 К, из которой определена энергия ионизации хрома в InSb, равная 78 МэВ. Минимальная концентрация электронов, доступная для измерения описываемым методом, составляет $\sim 10^{10}$ см⁻³. Полученное из $\Gamma_e(H, \omega)$ и n_c в [48] магнитосопротивление $\sigma_\perp(H)$ не зависит от частоты и совпадает с $\sigma_0(H)$ на постоянном токе. Заметим, что методика определения σ_\perp и $n_c(T)$ из $\Gamma_e(H, \omega)$ использована в [48], поскольку существующая поверхностная проводимость в исследуемом n -InSb искажает результаты измерений на постоянном токе.

Коэффициент поглощения пьезоактивного звука в прыжковом режиме связан с ВЧ прыжковой проводимостью $\sigma_{qq}(\omega)$:

$$\Gamma_e = 4.34 \frac{k^2}{\pi s} 4\pi \sigma_{qq}(\omega). \quad (6)$$

Физическая картина прыжковой проводимости в области ультразвуковых частот заметно отличается от соответствующей для статической проводимости, так же как и характер поглощения ультразвука не похож на СВЧ поглощение. Если в статическом случае важно, чтобы возникла цепь прыжков, соединяющая грани образца (путь протекания), а в миллиметровой и субмиллиметровой областях главную роль играют резонансные переходы между основным и высшими возбужденными состояниями D_2^+ -комплексов [23], то в ВЧ случае (при достаточно высоких частотах) эффект обусловлен прыжками электронов между основными состояниями двух доноров, расстояние между которыми гораздо меньше среднего [49]. Эти же сближенные пары центров, состоящие из нейтрального и ионизованного доноров, энергетический зазор между двумя нижними термами которых $\Delta e \ll kT$, играют основную роль в поглощении ультразвука.

Пьезоэлектрическое поле звуковой волны приводит к модуляции во времени расстояния между уровнями с частотой ω и изменению вследствие этого заселенности уровней, которое из-за взаимодействия локализованных электронов с тепловыми фононами отстает по фазе от пьезоэлектрического поля. В итоге происходит диссиляция энергии звуковой волны в электронной системе, приводящая к поглощению ультразвука. Указанный механизм релаксационного поглощения был впервые рассмотрен Поллаком и Джеболлом [49], анализу его посвящены также работы [50–52]. Отметим, что при достаточно высоких частотах и сверхнизких температурах главным может оказаться не этот, а резонансный механизм поглощения ультразвука [49]. Здесь мы его подробно не обсуждаем (см., например, [50, 51]).

В [50, 51], в частности, показано, что в реализуемой в n -InSb ситуации $\omega \tau_0(kT) \ll 1$ [$\tau_0(kT)$ — минимальное время релаксации пары при данном значении энергии], поглощение (в основном приближении) пропорционально частоте ω . Отношение $\sigma(\omega)/\omega$, равное $\Gamma_e^{(h)}/\Gamma_0$ [где $\Gamma_0 = 4.34 (4\pi\omega/\pi s)$], в этом режиме не зависит (с логарифмической точностью) от частоты звука и имеет физический смысл эффективной концентрации сближенных пар, дающих вклад в поглощение. Таковыми являются пары с расстоянием между нижними уровнями $\Delta e \ll kT$ и «плечом» $r \approx a \ln \{2I/(kT\sqrt{\omega \tau_0(kT)})\}$.⁶ В рассматриваемом n -InSb — это D_2^+ -комpleksy с расстоянием в паре $r \gg 3a$, а Δe соответствует разнице энергий термов $\epsilon_{2p_{3/2}}$ и ϵ_{1s5_g} (рис. 8).

Во внешнем магнитном поле волновые функции примесных электронов деформируются: из сферически симметричных они становятся сигарообразными (сильно сжатыми в плоскости, перпендикулярной H , и относительно слабо — в направлении H). Характерный размер электронного состояния в плоскости, перпендикулярной H , — магнитная длина $\Lambda = (c\hbar/eH)^{1/2}$, а в направлении

⁶ Теоретические оценки концентрации таких пар приведены в [52] и в обзоре [50].

H — некоторая величина $a_H < a$, убывающая в достаточно широкой области значений H , как $H^{-1/2}$. Деформация волновых функций в магнитном поле приводит к уменьшению интеграла перекрытия I с ростом H . Поэтому число пар с $\Delta\epsilon \leq kT$ и заданным значением r уменьшается с ростом H . Другими словами, магнитное поле уменьшает вероятность туннельных переходов между центрами и подавляет прыжковый вклад в поглощение, что приводит к монотонному убыванию $\Gamma(H)$, оно становится заметным при $H > H_0$, где

$$H_0 = \left(\frac{c\hbar}{e}\right)^2 \frac{1}{a^2}, \quad (7)$$

для n -InSb $H_0 = 1.6$ кЭ.

Таким образом, разность $|\Delta\Gamma| = |\Gamma(H) - \Gamma(0)|$ равна прыжковому вкладу в поглощение при $H=0$.

Прыжковое поглощение в магнитном поле зависит от угла между q и H , причем, как легко понять, при $q \perp H$ поглощение должно убывать быстрее с ростом H . Теоретический расчет [51] дает, что в пренебрежение логарифмическими зависимостями при $H > H_0$,

$$\begin{aligned} \Gamma_e &\sim H^{-1/2} \text{ при } q \parallel H, \\ \Gamma_e &\sim H^{-2} \text{ при } q \perp H. \end{aligned} \quad (8)$$

Впервые прыжковое поглощение звука наблюдалось экспериментально авторами [53] в CdS в отсутствие магнитного поля и затем в p -InSb в магнитном

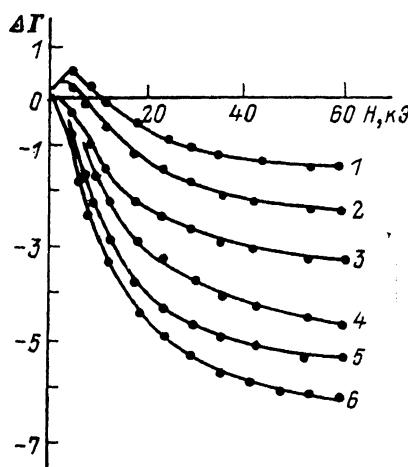


Рис. 10. Зависимость изменения поглощения в магнитном поле $\Delta\Gamma = \Gamma(H) - \Gamma(0)$ от магнитного поля H .

Образец 7, $T=4.2$ К, f , МГц: 1 — 150, 2 — 205, 3 — 400, 4 — 448, 5 — 570, 6 — 750.

поле [54]. В предельно очищенном n -InSb на наличие прыжковой проводимости при низких температурах указывалось в [55, 56]. В большинстве работ наблюдался прыжковый вклад на фоне вклада свободных электронов.

В [57, 58] исследовано поглощение продольных пьезоактивных волн в слабо легированных сильно компенсированных ($K \gg 0.8$) образцах n -InSb, где прыжковый вклад в $\sigma(\omega)$ практически не маскируется зонными носителями. Измерения выполнены на частотах 150–750 МГц при $T=4.2 \div 1.9$ К и $H=0 \div 60$ кЭ. Использована продольная пьезоактивная волна, распространяющаяся вдоль оси [111] в конфигурациях $q \parallel H$ и $q \perp H$. Исследование выполнено на образцах 6–9 (табл. 2).

На рис. 10 представлены графики зависимостей коэффициента поглощения $\Delta\Gamma$ от магнитного поля для образца 7 при $T=4.2$ К в диапазоне частот 150–750 МГц [57]. Видно, что характер поведения $\Delta\Gamma = \Gamma(H) - \Gamma(0)$ различен при высоких ($f \geq 330$ МГц) и низких ($f \leq 205$ МГц) частотах: в первом случае $\Delta\Gamma$ монотонно убывает с ростом H , во втором — $\Delta\Gamma$ сначала положительно, а затем, проходя через максимум, меняет знак и далее монотонно убывает. Представленные на рис. 11 графики $\Delta\Gamma$ образца 7 ($f=150$ МГц) показывают, что с понижением температуры максимум $\Delta\Gamma$ уменьшается по величине и смещается в сторону меньших полей, а при $T \leq 2.7$ К вообще исчезает.

Кардинальное отличие графиков $\Delta\Gamma(H)$ рис. 10 и 11 от соответствующих зависимостей на рис. 9 авторами [57] объясняется существованием релаксационного поглощения ультразвука в примесной зоне компенсированного n -InSb. Подтверждением этого является то, что в соответствии с [51] $\Delta\Gamma \sim H^{-1/2}$ при $H > 20$ кЭ и $f \geq 330$ МГц и что $\Delta\Gamma/\Gamma_0$ не зависит от частоты.

На вставке к рис. 12 представлен график $\Delta\Gamma(K)$ при $H=60$ кЭ и $T=4.2$ К, построенный по данным [57]. Видно, что прыжковое поглощение звука сущест-

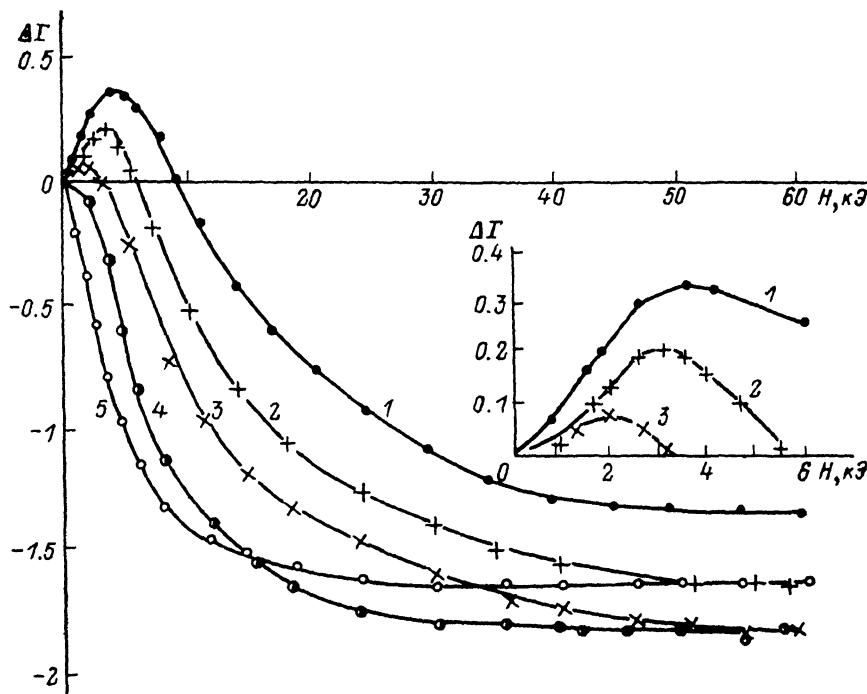


Рис. 11. Зависимость $\Delta\Gamma$ от магнитного поля при разных температурах.
Образец 7, $f=150$ МГц. T, K : 1 — 4.2, 2 — 4.02, 3 — 3.5, 4 — 2.7, 5 — 1.9. На вставке — температурная зависимость поглощения в относительно слабых H в увеличенном масштабе.

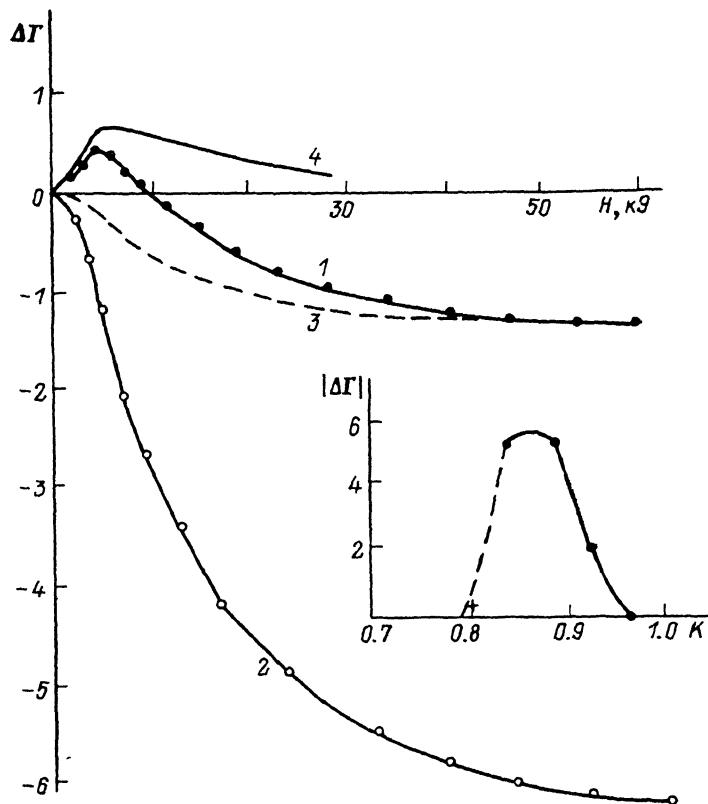


Рис. 12. Процедура разделения вкладов свободных и локализованных на донорных парах электронов в поглощение ультразвука.

Образец 7, $T=4.2$ К. 1, 2 — экспериментальные зависимости $\Delta\Gamma(H)$, МГц; 1 — 150, 2 — 750. 3 — прыжковый вклад в поглощение, 4 — вклад свободных электронов. На вставке — зависимость $|\Delta\Gamma|$ от компенсации. $f=630$ МГц, $T=4.2$ К, $H=0$ [$\text{a}, \text{в}$].

ствует при $T=4.2$ К в относительно узком диапазоне компенсаций $0.8 < K < 0.95$. Это можно, по-видимому, объяснить отсутствием донорных пар типа D_2^+ при $K < 0.8$ и заселенностью в основном при $K \geq 0.95$ D_2^- -комплексов с $r/a \approx 1.5$, для которых $\Delta\epsilon = \epsilon_{2p_{3/2}} - \epsilon_{1s_{1/2}} \gg kT$ [23, 36].

Нам представляется исключительно важным результатом [11] выделение вклада свободных электронов в проводимость сильно компенсированного материала, что в n -InSb невозможно сделать никакими, кроме ультразвуковых, методами. О существовании поглощения ультразвука на свободных электронах при $T \approx 4$ К и $f \leq 200$ МГц свидетельствует то, что в слабых магнитных полях $\Delta\Gamma > 0$ и немонотонно изменяется с ростом H .

В общем случае вклад в поглощение ультразвука свободными и локализованными электронами не является аддитивным. Однако в [51] показано, что в слабо легированном материале аддитивность имеет место при

$$\sqrt{(q/\eta)^4 + \omega^2 \tau_M^2} \gg 1, \quad (9)$$

что в условиях данного эксперимента выполняется.

На рис. 12 на примере образца 7 показана процедура разделения вклада в поглощение ультразвука за счет свободных и локализованных на донорных парах электронов. При этом для каждого образца используется тот факт, что при $f = 750$ МГц поглощение на свободных электронах практически отсутствует и что $\sigma_{qq}(\omega)/\omega = |\Delta\Gamma|/\Gamma_0$ не зависит от частоты.

Для количественного определения вклада свободных электронов в проводимость при $T = 4.2$ К выражение (4) непригодно, поскольку для справедливости его помимо условия $ql \ll 1$ требуется также выполнение неравенства

$$\max\{\omega, q\mu kT/e\} \gg \tau_e^{-1}, \quad (10)$$

где τ_e — время релаксации энергии электронов. В n -InSb при $T = 4.2$ К главный вклад в энергетическую релаксацию дает пьезоакустическое рассеяние, причем $\tau_e \approx 10^{-8}$ с. Таким образом, $\omega \tau_e \gg 1$, поэтому для обработки результатов использована более общая теория [59, 60]:

$$F_e(H, \omega) = \frac{4\pi k^2 e n_c \mu_r}{zs} F_\xi \left(\frac{\omega \mu_r kT}{es^2} \right), \quad (11)$$

$F_\xi(z)$ — некоторый интеграл, содержащий в качестве параметра $\xi = \partial \ln \mu / d \ln T$. Согласно [7], $\xi = 1$ (предположение о том, что $\xi = 1.5$, следующее из формулы Брукса—Херринга, мало меняет результат). Расчет показал, что в интересующей нас области значений z функция $F_1(z)$ описывается простой интерполяционной формулой

$$F_1(z) = (1 + 5.7z)^{-1}. \quad (12)$$

Для определения n_c по (11) необходимо предварительно найти подвижность электронов $\mu_c(H)$. Для этого использована (помимо изображенных на рис. 11) экспериментальная зависимость $\Gamma_e(H)$ при $f_3 = 205$ МГц. Подвижность определялась по формуле

$$\mu_c = \frac{es}{11.4\pi kT} \frac{\Gamma_{e3} - \Gamma_{e1}}{\Gamma_{e1}f_1 - \Gamma_{e3}f_3}, \quad (13)$$

где Γ_{e1} и Γ_{e3} — вклады свободных электронов на частотах f_1 и f_3 соответственно. В итоге получены значения подвижности $2.2 \cdot 10^5$ и $2.5 \cdot 10^5$ см 2 /В·с для образцов 7 и 6 соответственно; оказалось, что μ_c слабо зависит от магнитного поля.⁷

По известным значениям μ_c из кривой 4 рис. 12 с использованием соотношений (11) и (12) определялась зависимость $n_c(T)$, причем при $H \leq 7$ кЭ она практически линейна. Действительно, в области квантового предела ($\hbar\omega_c = kT$ при $H = 100$ Гц, Э), концентрация свободных электронов равна

$$n_c = N_c f(K) \frac{\hbar\omega_c}{2kT} \exp \left(-\frac{\epsilon_{dH}}{kT} \right), \quad (14)$$

⁷ Расчет по формуле Брукса—Херринга по данным табл. 2 дает значения $1.7 \cdot 10^5$ и 1.8×10^5 см 2 /В·с соответственно.

где $N_e = 7.2 \cdot 10^{12} T^{3/2}$, см^{-3} — плотность состояний на дне зоны проводимости при $H=0$. Множитель $f(K)$ при $\Delta\varepsilon_d \ll kT$ ($\Delta\varepsilon_d$ — ширина примесной полосы) равен $(1-K)K$. Для образцов, в которых $kT < \Delta\varepsilon_d \leq \varepsilon_{dh}$, явный вид $f(K)$ неизвестен.

Линейность зависимости $n_e(T)$ при $H \leq 7$ кЭ свидетельствует о том, что в этой области полей ε_{dh} от H практически не зависит (значения ε_{dh} приведены в табл. 2). На рис. 13 представлены теоретическая зависимость энергии ионизации атома водорода от напряженности магнитного поля ε_{dh} (по [61]) и экспериментальные значения ε_{dh} , полученные по $n_e(T)$ и из статического магнито-сопротивления [11]. Видно, что независимые экспериментальные результаты практически совпадают и вплоть до $H \leq 15$ кЭ превышают теоретические значения ε_{dh} . Это характерно только для сильно компенсированного $n\text{-InSb}$, поскольку при $K < 0.7$ экспериментальные значения ε_{dh} всегда ниже расчетных, по крайней мере до $H \leq 20$ кЭ (см., например, [62]). Превышение экспериментальных значений ε_{dh} над расчетными при $H \leq 15$ кЭ является, вероятно, следствием локализации электронов на донорных комплексах типа D_2^+ [23], которые при $H \geq 15$ кЭ, по-видимому, распадаются.

Концентрации электронов n_e в образцах 6 и 7 при $T=4.2$ К и $H=5$ кЭ со-

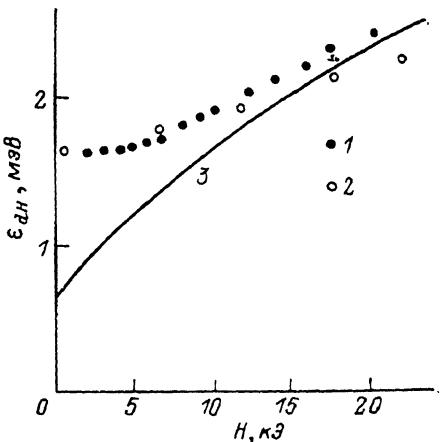


Рис. 13. Зависимости энергии ионизации ε_{dh} от магнитного поля в образце 7, определенные по поглощению ультразвука (1) и из $\rho(T, H)$ (2).

з — теоретический расчет [61].

ответственно составляют $1.4 \cdot 10^{10}$ и $1.4 \cdot 10^{11}$ см^{-3} . Они существенно меньше этого значения, которое можно получить из измерения постоянной Холла. Так, например, в образце 7 $n_e = (eR_H)^{-1} = 2.5 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-3}$. Причину столь сильного расхождения авторы [11] видят в том, что в $R_H(T)$ наряду со свободными дают вклад электроны зоны ε_3 . Грубая оценка $R_H(T)$, исходя из двузонной модели (зоны проводимости и зона ε_3), при $\mu_a/\mu_c = 10^{-2}$, $n_a \approx N_d - N_a$ и $n_c = 1.4 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-3}$ дает $R_H \sim 10^{-2} (en_c)^{-1}$. Такая величина R_H вполне разумно согласуется с измеряемой в образце 7 при $T=4.2$ К.

Ультразвуковые измерения показывают, что при гелиевых температурах проводимость за счет свободных электронов $\sigma_e = en_c\mu_e$ составляет небольшую долю от полной проводимости σ_0 ; так, при $T=4.2$ К в образце 7 $\sigma_e \approx 5 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1} \approx 0.12 \sigma_0$ ($\sigma_0 = 4 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$).

В заключение настоящего раздела кратко обсудим результаты экспериментов по изучению нелинейных эффектов в поглощении ультразвука [58]. Интенсивная ультразвуковая волна приводит к ионизации донорных состояний с выбросом электронов в зону проводимости, вследствие чего прыжковый вклад в поглощение падает (как и при росте магнитного поля). В то же время при $H=0$ вклад в поглощение свободных электронов очень мал. Поэтому рост интенсивности звука должен приводить к «выключению» прыжкового вклада. Эта ситуация продемонстрирована на рис. 14, где приведены зависимости полного коэффициента поглощения Γ от магнитного поля в линейном режиме (правая ось абсцисс) и от интенсивности звука в отсутствие магнитного поля (левая ось абсцисс) для частоты 150 МГц (1). Кроме того, изображена зависимость статической проводимости σ_0 от поглощаемой мощности (2). Обращает на себя внимание то, что асимптотические значения $\Gamma(H \rightarrow \infty)$ и $\Gamma(P \rightarrow \infty)$, соответствующие электронному вкладу в поглощение, совпадают. Рост электропроводности с увеличением P соответствует возрастанию концентрации свободных электронов за счет примесного пробоя. Совокупность результатов, приведенная на рис. 14, в сочетании с результатами СВЧ спектроскопии сви-

действует в пользу того, что в исследованных образцах n -InSb примесная зона отделена от зоны проводимости и проводимость по ней прыжковая.

6. Модель фотопроводимости по примесям

Анализ кинетических явлений в n -InSb будет неполным, если не рассмотреть особенности фотопроводимости (ФП) в этом материале. В настоящее время широкое распространение в суб- и миллиметровом диапазонах волн получили детекторы излучения из n -InSb, охлажденного до гелиевых температур. Это объясняется их высокой чувствительностью и простотой. Лучшие приемники на основе n -InSb при $T=4.2$ К имеют вольтваттную чувствительность $S_u \approx 3 \cdot 10^3$ В/Вт и предельную чувствительность $P_{np} = 3 \cdot 10^{-13}$ Вт/Гц².

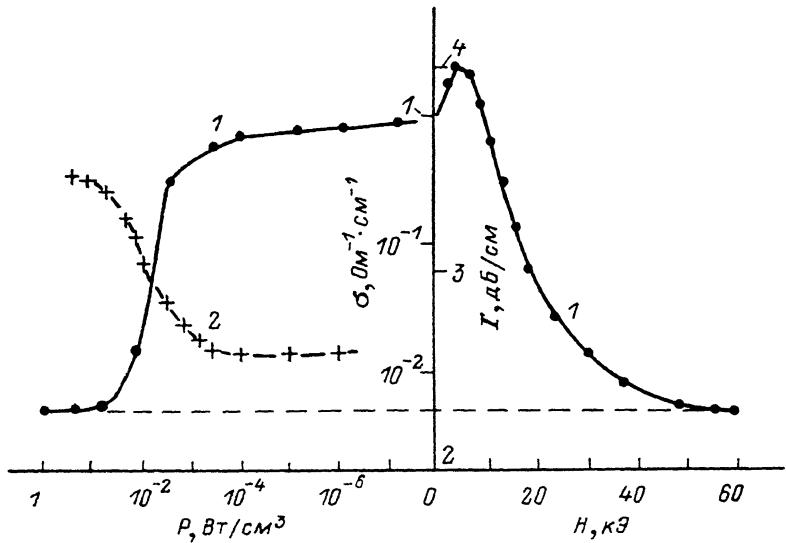


Рис. 14. Зависимости поглощения ультразвука в образце 7 от H в линейном режиме (правая ось абсцисс) и от интенсивности звука при $H=0$ (левая ось абсцисс) (1).

$T=4.2$ К, $f=150$ МГц. 2 — статическая проводимость при $H=0$. Штриховая линия — асимптотика Γ при $H \rightarrow \infty$ и $P \rightarrow \infty$.

Отличительной особенностью ФП в n -InSb является отсутствие «красной» границы эффекта, что, на первый взгляд, исключает какие-либо фотоионизационные процессы. В связи с этим значительное распространение получила модель так называемой « μ -фотопроводимости» (μ -ФП) [63-65]: под действием электромагнитного излучения увеличивается эффективная температура электронов, вследствие чего в условиях рассеяния на ионизованных примесях растут их подвижность μ , а значит, и σ . Однако модель μ -ФП, с нашей точки зрения, противоречит ряду экспериментальных фактов, в частности возрастанию чувствительности детекторов с увеличением K , и не объясняет зависимости $S_u(T, H)$ и $P_{np}(T, H)$. Для сильно компенсированного n -InSb, наиболее перспективного для создания высокочувствительных детекторов, реально достижимые значения S_u существенно превосходят рассчитанные на основе модели μ -ФП [66]. И последнее, модель μ -ФП подразумевает проводимость при $T=4.2$ К за счет свободных электронов, в то время как результаты гальваномагнитных измерений, спектры поглощения и характер поглощения ультразвука свидетельствуют о преобладании при этих температурах проводимости по примесям.

Локализация электронов на примесях должна определять фотоионизационный механизм ФП. Однако это не обычная примесная ФП. Суть ее в следующем [67, 68]: независимо от того, в какое состояние попадает электрон непосредственно после поглощения фотона, за время $\tau \ll \tau_\phi$ (τ_ϕ — время релаксации ФП) он попадает в полосу примесных состояний и, двигаясь по примесям, уча-

ствует в ФП. При этом характер движения такой же, как и электронов, определяющих статическую проводимость в отсутствие света.

При $K > 0.85$ ФП, как и статическая проводимость, обусловлена прыжковым движением электронов либо по уровню протекания в примесной зоне ($\hbar\omega \geq \epsilon_3 > kT$), либо по состояниям вблизи уровня Ферми ($\hbar\omega < \epsilon_F$). В рамках такой модели ФП по примесям рассматривается как процесс, аналогичный статической проводимости, с той разницей, что для перехода электрона в более высокое энергетическое состояние требуется поглощение не фонона, а фотона.

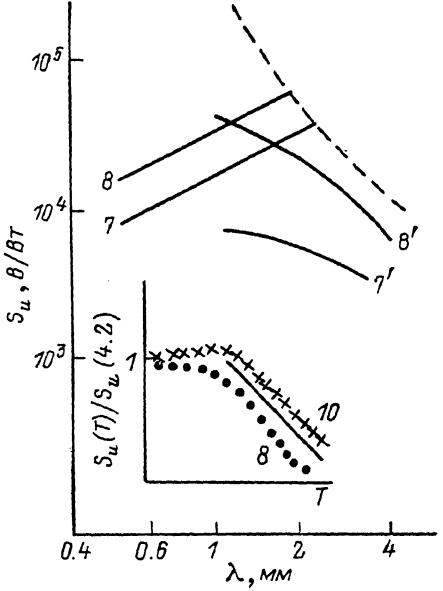
В связи с отсутствием теории прыжковой фотопроводимости (ПФП) авторами [67, 69] для оценки величины ФП использованы формулы, выведенные для статической прыжковой проводимости. Приближенные выражения для S_u детекторов в случае, когда ФП и статическая проводимость осуществляются по одним и тем же состояниям, имеют вид [69]: 1) ПФП и статическая проводимость обусловлены движением электронов по примесному уровню протекания

$$S_u = \frac{\alpha \tau_\phi \epsilon_3 U}{d \hbar \omega k T (N_d - N_a)} \exp\left(\frac{\epsilon_3}{kT}\right), \quad (15)$$

где d — площадь примесной площадки детектора, $\hbar\omega$ — энергия кванта излучения, U — напряжение на образце; 2) ПФП и статическая проводимость осуществляются по состоянию вблизи уровня Ферми

Рис. 15. Зависимости вольтваттной чувствительности от длины волны в n -InSb [69].

Номера у кривых соответствуют номерам образцов из табл. 2, параметры которых использованы в расчетах. Расчет: 7, 8 — по (15); 7', 8' — по (16). Штриховая кривая соответствует λ_{\max} , определяемому из условия $\hbar\omega = \epsilon_F$. На вставке — зависимости $S_u(T)/S_u(4.2 \text{ K})$ для образцов 8 и 10 при $\lambda = 8 \text{ мм}$ и результаты расчета по (17).



$$S_u = 4 \cdot 10^{-2} \frac{\alpha \tau_\phi a^{*3} (kT_0)^{7/4}}{d (\hbar\omega)^{5/4} (kT)^{1/2}} \exp\left[\left(\frac{T_0}{T}\right)^{1/4} - \frac{1}{2} \left(\frac{kT_0}{\hbar\omega}\right)^{1/4}\right], \quad (16)$$

где a^* — характерная длина спада волновых функций состояний, между которыми происходят прыжки; T_0 — постоянная, зависящая от плотности состояний на уровне Ферми $g(\epsilon_F) \sim (T_0 a^{*3})^{-1}$.

Соотношение (15) записано в предположении, что $\hbar\omega \geq \epsilon_3$; при выводе (16) считалось, что плотность состояний на уровне Ферми постоянна (это приближение оправдано, поскольку подобная ФП наблюдается в n -InSb с $K \geq 0.90$) и $\hbar\omega \geq kT$. В последнем случае средняя длина прыжка электрона R при поглощении фотона определяется соотношением [42]

$$\frac{4\pi}{3} R^3 g(\epsilon_F) \hbar\omega \approx 1.$$

Расчет величины S_u по (15) и (16) при двух эмпирических параметрах $\alpha = 15 \text{ см}^{-1}$ и $\tau_\phi = 4 \cdot 10^{-7} \text{ с}$ [67] дает $S_u = (3 \div 10) \cdot 10^3 \text{ В/Вт}$, что находится в удовлетворительном соответствии с экспериментальными данными.

На рис. 15 представлены зависимости $S_u = f(\lambda)$ для рассмотренных механизмов прыжковой ФП при двух значениях ϵ_3 и T_0 , характерных для образцов 7 и 8 (табл. 2). Видно, что значения S_u для различных механизмов ПФП близки, а кривые $S_u(\lambda)$ перекрываются. Таким образом, становится понятной неселективность детекторов из n -InSb: с изменением λ происходит непрерывный переход от одного механизма ПФП к другому. Кроме того, объясняется хорошо

известный факт [66], что максимальной чувствительностью детекторы обладают при $\lambda = 1 \div 2$ мм.

В [69] производится сопоставление экспериментальных результатов с соотношениями работы [70] для случая $kT \gg \hbar\omega$, когда ПФП описывается соотношением

$$\frac{\Delta U_\Phi}{U} \sim \frac{\Delta\sigma}{\sigma} \sim \left(\frac{eER}{kT} \right)^2 \sim T^{-\frac{3}{2}}, \quad (17)$$

где E — электрическая составляющая СВЧ поля.

На вставке к рис. 15 представлены экспериментальные зависимости $S_n(T)/S_n$ (4.2 К) для образцов 10 и 8 при $\lambda = 8$ мм и результаты расчета по (17).. Видно, что при $\hbar\omega \ll kT$ ($T > 8$ К) экспериментальные зависимости $S_n(T)$ такие же, как расчетные.

В [69] также объяснено в рамках ФП по примесям влияние магнитного поля на S_n и P_{np} .

Заключение. Резюмируя результаты комплексных исследований n -InSb, необходимо отметить, что в материале с $N_d \approx (1 \div 1.5) \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ при $K \geqslant 0.2$ и $T \leqslant 4.2$ К электроны в основном локализованы на примесях. Однако конкретный вид примесных состояний и проводимость по ним не одинаковы при различных компенсациях.

Отметим, что представление о механизмах низкотемпературной проводимости в Ge и Si сформировалось на основании анализа данных гальваниомагнитных измерений (см., например, [30]). В n -InSb из-за малости характерных энергий и значительного уровня легирования даже предельно очищенного материала ($N_d \sim 10^{14} \text{ см}^{-3}$) результаты гальваниомагнитных измерений не допускают однозначной интерпретации.

Однако малость характерных энергий и большой радиус локализации электрона на доноре обеспечили возможность проведения ряда исследований, не доступных для Ge и Si. Это в первую очередь исследование спектральной зависимости коэффициента поглощения и особенностей поглощения ультразвука на свободных и локализованных электронах. В результате таких комплексных исследований удалось установить характер примесной проводимости и примесных состояний в зависимости от N_d и K .

Мы старались показать, что физические явления в n -InSb в основном сходны с характерными для таких классических полупроводников, как Ge и Si. Действительно, особенности проводимости ϵ_2 в n -InSb такие же, как в Ge [30]. Вслед за n -InSb примесные комплексы $D_2^+(H_2^+)$ были обнаружены в n -GaAs и n -InP [39, 40], и на примере всей группы материалов поняты особенности молекулярных спектров в полупроводниках в зависимости от r/a . И, наконец, обнаруженная в Ge прыжковая ФП при межзонном подсвете [71] идентична ПФП в n -InSb в суб- и миллиметровом диапазонах волн. Механизм прыжковой ФП привлекается для объяснения ФП в алмазе, легированном бором [72].

Список литературы

- [1] Гершензон Е. М., Ильин В. А., Литвак-Горская Л. Б., Рабинович Р. И., Шапиро Е. З. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 10. С. 1883—1888; 1972. Т. 6. В. 10. С. 1906—1910.
- [2] Kaplan R. // Phys. Rev. 1969. V. 181. N 3. P. 1154—1162.
- [3] Raymond A. // Lect. Not. Phys. 1983. V. 177. P. 344—355.
- [4] Oka J., Narita S. // J. Phys. Soc. Japan. 1970. V. 28. N 3. P. 674—683.
- [5] Гершензон Е. М., Фогельсон М. С., Халитов В. Ю. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 9. С. 1548—1553.
- [6] Tokumoto H., Mansfield R., Lea M. J. // Sol. St. Commun. 1980. V. 35. N 12. P. 961—964. Phil. Mag. B. 1982. V. 6. N 2. P. 93—113.
- [7] Гершензон Е. М., Куриленко И. Н., Литвак-Горская Л. Б., Рабинович Р. И. // ФТП. 1973. Т. 7. В. 8. С. 1501—1503.
- [8] Nag B. R., Dutta G. M. // Phys. St. Sol. 1975. V. 71B. N 1. P. 401—410.
- [9] Шик А. Я. // Письма ЖЭТФ. 1974. Т. 20. В. 1. С. 14—16.
- [10] Литвак-Горская Л. Б., Шапиро Е. З. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 11. С. 1970—1974.
- [11] Гальперин Ю. М., Дричко И. Л., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 1. С. 124—128.
- [12] Гершензон Е. М., Ивлева В. С., Куриленко И. Н., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 10. С. 1982—1987.

- [13] Блэкмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках. М., 1964. 392 с.
- [14] Афиногенов В. М., Трифонов В. Г. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 7. С. 1256—1263.
- [15] Банная В. Ф., Гершензон Е. М., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1962. Т. 2. В. 7. С. 978—984; 1970. Т. 4. В. 1. С. 200—207.
- [16] Лянь-чи-чао, Наследов Д. Н. // ФТТ. 1961. Т. 3. В. 6. С. 1185—1189.
- [17] Miyazawa H., Ikoma H. // J. Phys. Soc. Japan. 1967. V. 23. N 1. P. 290—305.
- [18] Ishida Sh., Otsuka S. // J. Phys. Soc. Japan. 1977. V. 42. N 2. P. 542—547.
- [19] Lifshits T. M., Oleinikov A. Ya., Shulman A. Ya. // Phys. St. Sol. 1966. V. 14. N 2. P. 511—521.
- [20] Sandercock Y. R. // Proc. Phys. Soc. 1965. V. 86. N 6. P. 1221—1224.
- [21] Гершензон Е. М., Ильин В. А., Куриленко И. Н., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 9. С. 1687—1692.
- [22] Гершензон Е. М., Ильин В. А., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1974. Т. 8. В. 2. С. 295—300.
- [23] Арендарчук В. В., Гершензон Е. М., Литвак-Горская Л. Б., Рабинович Р. И. // ЖЭТФ. 1973. Т. 65. В. 6. С. 2387—2398.
- [24] Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. М., 1974. 472 с.
- [25] Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. Электронные свойства легированных полупроводников. М., 1979. 416 с.
- [26] Fritzsch H. // Phys. Rev. 1955. V. 99. N 2. P. 406—416. J. Phys. Chem. Sol. 1958. V. 6. N 1. P. 69—80.
- [27] Гершензон Е. М., Литвак-Горская Л. Б., Луговая Г. Я. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 7. С. 1284—1292.
- [28] Нгуен Ван Лиен, Шкловский Б. И., Эфрос А. Л. // ФТП. 1979. Т. 13. В. 11. С. 2192—2209.
- [29] Sladek R. J. // J. Phys. Chem. Sol. 1958. V. 5. N 1. P. 157—170.
- [30] Davis W. D. // Phys. Rev. 1965. V. 140. N 6A. P. 2183—2194.
- [31] Забродский А. Г., Ионов А. Н., Корчажкина Р. Л., Шлимак И. С. // ФТП. 1973. Т. 7. В. 10. С. 1914—1918.
- [32] Арендарчук В. В., Гершензон Е. М., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1973. Т. 7. В. 1. С. 132—137.
- [33] Выставкин А. Н., Губанков В. Н., Листвин В. Н. // ФТТ. 1966. Т. 8. В. 2. С. 443—447.
- [34] Потапов В. Т., Трифонов В. И., Чусов И. И., Яременко Н. Г. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 7. С. 1227—1233.
- [35] Слэтер Дж. Электронная структура молекул. М., 1965. 587 с.
- [36] Атомные и молекулярные процессы / Под ред. Д. Р. Бейтса. М., 1964. 777 с.
- [37] Golka J., Pida L. // Sol. St. Commun. 1977. V. 21. N 7. P. 691—693. Golka J. // J. Phys. C. 1974. V. 7. N 22. P. L407—L410.
- [38] Кальфа А. А. // ФТП. 1976. Т. 10. В. 1. С. 47—52.
- [39] Vaaja K. K., Birch J., Eaves J., Hoult R. A., Kirkkman R. F., Simmond P. E., Stradling R. A. // J. Phys. C. 1975. V. 8. N 2. P. 530—540.
- [40] Берман Л. В., Кальфа А. А. // ФТП. 1976. Т. 10. В. 12. С. 2251—2255.
- [41] Кальфа А. А., Литвак-Горская Л. Б. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 5. С. 920—924.
- [42] Костадинов И. З. // Письма ЖЭТФ. 1971. Т. 14. В. 5. С. 345—348.
- [43] Костадинов И. З. // Тр. VI Межд. конф. по аморфным и жидким полупроводникам. Л., 1976. Т. 1. С. 156—159.
- [44] Гуревич В. Л. // ФТТ. 1962. Т. 4. В. 4. С. 909—917.
- [45] White D. L. // J. Appl. Phys. 1962. V. 33. N 8. P. 2547—2554.
- [46] Гуревич В. Л. // ФТП. 1968. Т. 2. В. 11. С. 1557—1592.
- [47] Steel M. C. // RCA Rev. 1967. V. 28. N 1. P. 58—63.
- [48] Векшина В. С., Дричко И. Л., Пепик Н. И. // ФТТ. 1984. Т. 26. В. 7. С. 2048—2052.
- [49] Pollak M., Geballe T. H. // Phys. Rev. 1961. V. 122. N 6. P. 1742—1753.
- [50] Efros A. L., Shklovskyi B. I. // Modern problems in condensed matter science. Amsterdam, 1985. V. 10. P. 409—482. ЖЭТФ. 1981. Т. 81. В. 1. С. 406—415.
- [51] Гальперин Ю. М., Приев Э. Я. // ФТТ. 1986. Т. 28. В. 3. С. 692—700.
- [52] Гальперин Ю. М., Гуревич В. Л., Паршин Д. А. // ЖЭТФ. 1983. Т. 85. В. 11. С. 1757—1770.
- [53] Ганапольский Е. М., Тараканов В. В. // ФТТ. 1970. Т. 12. С. 3562—3568; 1972. Т. 14. В. 2. С. 487—491; 1981. Т. 23. В. 12. С. 3645—3651.
- [54] Madore G., Cheeke J. D. M. // Sol. St. Commun. 1984. V. 49. N 4. P. 331—333.
- [55] Marsalais R. M., Ducla-Soares E., Cheeke J. D. N. // J. Phys. C. 1984. V. 17. N 8. P. 3173—3178.
- [56] Tokumoto H., Mansfield R. // Japan. J. Appl. Phys. 1983. V. 22 (Suppl. 3). P. 196—198.
- [57] Гальперин Ю. М., Дричко И. Л., Литвак-Горская Л. Б. // ФТТ. 1986. Т. 28. В. 3. С. 701—707.
- [58] Гальперин Ю. М., Дричко И. Л., Литвак-Горская Л. Б. // ФТТ. 1986. Т. 28. В. 11. С. 3374—3379.
- [59] Липник А. А. // ФТП. 1972. Т. 6. В. 5. С. 878—891.
- [60] Каган В. Д. // ФТТ. 1974. Т. 16. В. 7. С. 2022—2026.
- [61] Fenton F. W., Heering R. R. // Phys. Rev. 1967. V. 159. N 3. P. 593—599.
- [62] Гершензон Е. М., Литвак-Горская Л. Б., Серебрякова Н. А., Смирнова В. Б. // ФТП. 1975. Т. 9. В. 4. С. 669—675.
- [63] Коган Ш. М. // ФТТ. 1962. Т. 4. В. 9. С. 2474—2484; 1962. Т. 4. В. 7. С. 1891—1896.
- [64] Putley E. H. // Appl. Opt. 1965. V. 4. N 3. P. 649—657.

- [65] Kinch M. A., Rollin B. V. // Brit. J. Appl. Phys. 1963. V. 14. N 10. P. 672—684.
- [66] Выставкин А. Н., Мигулин В. В. // Радиотехн. и электрон. 1967. Т. 12. В. 11. С. 1989—2005.
- [67] Гершензон Е. М., Ильин В. А., Литвак-Горская Л. Б., Филонович С. Р. // ЖЭТФ. 1979. Т. 76. В. 1. С. 238—250.
- [68] Гершензон Е. М., Ильин В. А., Литвак-Горская Л. Б., Филонович С. Р. // ФТН. 1979. Т. 13. В. 6. С. 1116—1122.
- [69] Гершензон Е. М., Литвак-Горская Л. Б., Филонович С. Р. // Радиотехн. и электрон. 1985. Т. 30. В. 10. С. 2045—2053.
- [70] Вьюрков В. В., Рыжий В. И. // ЖЭТФ. 1980. Т. 78. В. 3. С. 1158—1166.
- [71] Доброго В. П., Рывкин С. М. // ФТТ. 1964. Т. 6. В. 4. С. 1203—1207.
- [72] Смирнова О. И., Годик Э. Э., Гонтарь А. Г. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 5. С. 869—875.

Физико-технический институт им. А. Ф. Ноффе АН СССР

Получен 13.07.1989

Ленинград

Принят к печати 25.07.1989

Московский государственный педагогический
институт им. В. И. Ленина
